平成30年9月18日

委　員　各　位

日本学術振興会

薄膜第１３１委員会

委員長　近藤　高志

日本学術振興会　薄膜第１３１委員会

第285回委員会・第291回研究会

(半導体界面制御技術第154委員会合同研究会)

開催通知

1. 日　時　：　平成30年10月30日（火）

　　　　　　　　委員会　　　　　12:00～13:00 (昼食付き)

　　　　　　　　研究会　　　　　13:00～17:50

２．場　所　：　名古屋大学ベンチャービジネスラボ(VBL)3階　ベンチャーホール

　　　　　　 〒464-8603名古屋市千種区不老町B2-4，Tel: 052-789-5447

 名古屋市営地下鉄 「名古屋大学」 下車

 http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/access.html

３．研究会テーマ：「深層学習時代のニューロモルフィックハードウエア

（クラウドからエッジまで深層学習時代のデバイス技術）

４．プログラム：

　(0) はじめに 13:00～13:05

(1) 「ブレインモルフィックAI」の実用化と社会実装にむけて 13:05～13:50

 合原一幸　(東京大学)

 (2) 時間領域アナログ演算に基づく脳型処理モデルとデバイス開発 13:50～14:35

 の現状と展望

 森江隆 (九州工業大学)

 (3) 社会課題を解決　デジタルアニーラとは 14:35～15:20

 中村誠 (富士通研究所)

 ＜交流15：20～15:35＞

 (4) 原子スイッチを用いたニューロモルフィック応用 15:35～16:20

 長谷川剛 (早稲田大学)

 (5) ニューロモルフィック応用を目指した 16:20～17:05

 酸化物アナログ抵抗変化素子の開発

 島久、高橋慎、内藤泰久、秋永広幸　(産業技術総合研究所)

 (6) ニューロモルフィックハードウエア実現に向けた 17:05～17:50

 脳模倣型素子の研究開発と展望

 丸亀孝生　(東芝)

以上

※２委員会合同意見交換会

会場：名古屋大学ES総合館1階　レストラン　シェジロー，時間：18：00～19：30

参加費：2,000円（委員，代理），4,500円（同伴者）(参加申し込みは委員会・研究会出席調査回答に併せて行ってください．会費は当日に受付にてお納めください．)

研究会担当：宮崎誠一(131・154，名大)，大沢裕一(131，東芝)，浅野種正(131，九大)，久保田均(131，産総研)，須田淳(131，名大)，三浦博（131，リコー），原直紀（131，富士通研），井上和裕（131，村田製作所），筑根敦弘(154，大陽日酸)，長安芳彦(154，富士電機)，山本哲也(154，高知工科大)

＜　追　記　＞

1. 研究会等に関するお問い合わせ先

大沢 裕一(東芝)

Phone: 050-3190-8715（直通）E-mail: yuichi.osawa@toshiba.co.jp

044-549-2130

浅野 種正(九州大学)

Phone: 092-802-3741　　E-mail: asano@ed.kyushu-u.ac.jp

1. 研究会の参加につきましては､産業界委員が欠席される場合はなるべく代理の方に御出席いただきますようお願いいたします．また，委員の同伴者(複数名)は承認いたしますので，開催通知は関係部署に御回覧下さい．参加希望がございましたら，同伴者として氏名及び参加合計人数を御記入下さい．
2. 出欠を，日本学術振興会事業課(柴田様)からの開催案内に記されたガイダンスにしたがってウェブにてご回答ください．

【会場案内】

名古屋大学ベンチャービジネスラボ(VBL)　ベンチャーホール

 〒464-8603名古屋市千種区不老町B2-4

 Tel: 052-789-5447

 名古屋市営地下鉄 「名古屋大学」 下車　3番出口

 http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/access.html



